E DIN EN ISO 14644-10:2022-03 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2022-02-11

Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 10: Bewertung der chemischen Oberflächenreinheit (ISO/FDIS 14644-10:2021); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 14644-10:2021

Cleanrooms and associated controlled environments - Part 10: Assessment of surface cleanliness for chemical contamination (ISO/FDIS 14644-10:2021); German and English version prEN ISO 14644-10:2021

Inha	lt s	Seite
Europ	äisches Vorwort	<u></u> 9
Vorwo	ort	10
1	Anwendungsbereich	11
2	Normative Verweisungen	
3	Begriffe	
4	Prüfung und Beurteilung der chemischen Konzentration auf einer Oberfläche	12
4.1	Prinzipien zur Prüfung der Konzentration von chemischen	
	Oberflächenkontaminationen bei reinen Oberflächen in Reinräumen und Reinraumbereichen	12
4.2	Format des ISO-SCC-Deskriptors	
4.3	ISO-SCC-Bewertungsstufe	
4.4	Konverter für Stoffe in atomare Oberflächenkonzentration	
5	Messung der Oberflächenreinheit in Bezug auf chemische Kontamination und zum	
J	Nachweis der Übereinstimmung mit der Bewertungsstufe	15
5.1	Kriterien für eine gute Beurteilung der Reinheit	
5.2	Dokumentation und Auswertung	16
5.2.1	Prinzip	
5.2.2	Prüfung	
5.2.3	Prüfbericht	16
Anhan	ng A (informativ) Umrechnung zwischen unterschiedlichen Angaben von Maßeinheiten	
	der Oberflächenkonzentration bei chemischen Stoffen	18
A.1	Prinzip	
A.2	Beispiele	18
Anhan	ng B (informativ) Die Prüfung und Auswertung der Ergebnisse beeinflussende Parameter	25
B.1	Parameter	25
B.2	Überlegungen	25
Anhan	ng C (informativ) Wesentliche Aspekte einer guten Beurteilung der Reinheit	26
C.1	Prinzip	
C.2	Überlegungen	27
Anhan	ng D (informativ) Verfahren zur Prüfung der Oberflächenreinheit anhand der chemischen	
	Konzentration	28
D.1	Wahl des Verfahrens	28
D.1.1	Prinzip	
D.1.2	Messmatrix	
D.1.3	Allgemeines Anwendungsgebiet der hauptsächlichen Messverfahren	29
D.2	Kriterien für die Messung der Oberflächenreinheit anhand der chemischen	
	Konzentration	30

	llgemeines	. 30
D.2.2 A	nforderungen des Prüfverfahrens	. 30
D.2.3 D	Direkte oder indirekte Messverfahren	30
D.2.4 V	erpackung der Prüfproben	. 31
	Verfahren zur Vorbehandlung	
	Vergleichende Prüfverfahren	
	Direkte Messungen	
	ndirekte Messverfahren (Vorbehandlung und Messung)	
	Probenahme, Analyse und damit verbundene Elemente der Qualitätskontrolle	
D.Z.10 Q	Qualitätskontrolle der Analyse	. 42
_	E (informativ) Prüfprotokoll/Dokumentation	
Literatu	rhinweise	. 44
Bilder		
Bild 1 —	ISO-SCC-Bewertungsstufe als eine Funktion der Konzentration	. 14
	— Zusammenhang zwischen den Einheiten der Oberflächenmassenkonzentration (g/m^2) und der Oberflächenmolekularkonzentration (Moleküle/ m^2) bei typischen organischen Stoffen	. 21
	— Zusammenhang zwischen den Einheiten der Oberflächenkonzentration (g/m²) und den Oberflächenatomkonzentrationen bezogen auf die Kohlenstoffmasse (g C/m²) bei typischen organischen Stoffen	. 22
	 Zusammenhang zwischen den Einheiten der Oberflächenkonzentration (g/m²) und der Oberflächenatomkonzentration hinsichtlich der Kohlenstoffanzahl (Atome C/m²) bei typischen organischen Stoffen 	. 23
Bild A.4	 Zusammenhang zwischen den Einheiten der Oberflächenmassenkonzentration (g/m²) und der Oberflächenatomkonzentration hinsichtlich der Anzahl der Atome (Atome/m²) bei typischen organischen Stoffen 	. 24
Bild D.1	— Analyse der Oberflächenreinheit anhand der chemischen Konzentration: Bild der Messmatrix	. 28
Bild D.2	— Allgemeines Anwendungsgebiet der hauptsächlichen Messverfahren	. 29
	— Überblick über das Ablaufschema der Probenahme, Analyse und der damit verbundenen Elemente der Qualitätskontrolle	. 41
Bild D.4	— Ablaufschema der Qualitätskontrolle der Analyse mittels Siliciumscheibe TD-GC-MS	. 42
Tabellen		
Tabelle 1	1 — ISO-SCC-Bewertungsstufen	. 13
Tabelle A	A.1 — Darstellung des Zusammenhangs zwischen der Einheit der Oberflächenkonzentration [g/m²] und der Anzahlkonzentration auf der Oberfläche [Moleküle/m², Atome C/m²] bei Heptan (C ₇ H ₁₆), CAS-Nr. 142-82-5	. 18

Tabelle A	A.2 —	Darstellung	des	Zusammer	ıhangs	zwischen	der Ei	inheit	der
	Oberfläche	nkonzentrati	on [g/m ²	2] und der	Anzahlk	onzentratio	n auf der	Oberfl	äche
		m ² , Atome C/		-					
Tabelle A	Oberfläche [Moleküle,	Darstellung nkonzentratio m², Atomo 7-817-7	on [g/m² e C/m²	²] und der 1 ²] bei	Anzahlko Di-(2-E	onzentratio thylhexyl)p	n auf der hthalat	Oberfla (C ₂₄ H ₃₈	äche 8 0 4),
Tabelle A	A.4 — Konz	entration der	Monosch	icht, basie	rend auf L	.B-Film			20
Tabelle 1	D.1 — Direl	te Messverfal	hren und	deren Anv	vendunge	n			34
Tabelle 1	D.2 — Indir	ekte Messverf	fahren ur	nd deren Ai	nwendung	gen		•••••	38
Tabelle 1		fahren zur							